

<<薄膜物理与技术>>

图书基本信息

书名：<<薄膜物理与技术>>

13位ISBN编号：9787810167499

10位ISBN编号：7810167499

出版时间：2006-9

出版时间：电子科技大学出版社

作者：杨邦朝

页数：237

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<薄膜物理与技术>>

### 内容概要

《高等学校工科电子类规划教材：薄膜物理与技术》主要论述薄膜的制造技术与薄膜物理的基础内容。

书中系统介绍了各种成膜技术的基本原理与方法，包括蒸发镀膜、溅射镀膜、离子镀、化学气相沉积、溶液制膜技术以及膜厚的测量与监控等。

同时介绍了薄膜的形成，薄膜的结构与缺陷，薄膜的电学性质、力学性质、半导体特性、磁学性质以及超导性质等。

论述中注重基本概念的阐述，叙述尽量深入浅出，并注意到原理与技术相联系，理论与实践相结合。

《高等学校工科电子类规划教材：薄膜物理与技术》为电子材料与元器件专业的规划教材，亦可作为物理电子技术、半导体物理与器件、应用物理等专业的教材或教学参考书，同时亦可供从事电子元件、混合集成电路的工程技术人员参考使用。

## &lt;&lt;薄膜物理与技术&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章真空技术基础1-1真空的基本知识1-2稀薄气体的基本性质1-3真空的获得1-4真空的测量第二章真空蒸发镀膜法2-1真空蒸发原理2-2蒸发源的蒸发特性及膜厚分布2-3蒸发源的类型2-4合金及化合物的蒸发2-5膜厚和淀积速率的测量与监控第三章溅射镀膜3-1溅射镀膜的特点3-2溅射的基本原理3-3溅射镀膜类型3-4溅射镀膜的厚度均匀性第四章离子镀膜4-1离子镀原理4-2离子镀的特点4-3离子轰击的作用4-4离子镀的类型第五章化学气相沉积5-1化学气相沉积的基本原理5-2化学气相沉积的特点5-3CVD方法简介5-4低压化学气相沉积5-5等离子体化学气相沉积5-6其他化学气相沉积法第六章溶液镀膜法6-1化学反应沉积6-2阳极氧化法6-3电镀法6-4LB膜的制备第七章薄膜的形成7-1凝结过程7-2核形成与生长7-3薄膜形成过程与生长模式7-4溅射薄膜的形成过程7-5薄膜的外延生长7-6薄膜形成过程的计算机模拟第八章薄膜的结构与缺陷8-1薄膜的结构8-2薄膜的缺陷8-3薄膜结构与组分的分析方法第九章薄膜的性质9-1薄膜的力学性质9-2金属薄膜的电学性质9-3介质薄膜的电学性质9-4半导体薄膜的性质9-5薄膜的其他性质参考文献

<<薄膜物理与技术>>

编辑推荐

《薄膜物理与技术》由电子科技大学出版社出版。

<<薄膜物理与技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>